

2022年1月25日

AGC、EUV露光用フォトマスクブランクの生産能力を倍増

AGC（AGC株式会社、本社：東京、社長：平井良典）は、グループ会社であるAGCエレクトロニクス（本社：福島県郡山市、社長：佐藤弘昌）において、EUV露光用フォトマスクブランク（以下、EUVマスクブランク）の生産能力を増強することを決定しました。2023年1月より生産を開始し、段階的に増強を行うことにより、AGCグループのEUVマスクブランク生産能力は2024年に現在の約2倍になります。



EUV マスクブランク



EUV マスクブランクを製造する本宮工場

近年、半導体生産において EUV プロセスは、ロジック向けに加え DRAM^{*1}などのメモリー向けにおいても採用が進んでいます。これに伴う EUV マスクブランクの需要増に加え、次世代・次々世代半導体向け EUV マスクブランクの出荷も見込まれることから、今回生産能力の増強を決定しました。

AGCは、2003年に EUV 露光技術を用いた半導体生産プロセスで用いられるフォトマスクブランクの研究開発に着手しました。自社で保有するガラス材料技術、ガラス加工技術、コーティング技術などを融合し技術開発を進め、2017年に EUV マスクブランク生産を開始。「ガラス材料」から「コーティング」までを一貫して手掛けることができる、世界で唯一の EUV マスクブランクメーカーとして、市場のニーズに応じ必要な投資を段階的に実施し、2020年7月には AGC エレクトロニクスにおいて、建屋拡張を含めた大型増強工事を決定し^{*2}、2022年1月に生産を開始しています。

AGC グループは、経営方針 **AGC plus 2.0**のもと、エレクトロニクス事業を戦略事業のひとつと位置付けています。今後も大きな需要の伸びが見込まれる EUV マスクブランク事業に対し積極的な設備投資を実施し、2025年には売上高400億円以上を目指すとともに、半導体産業の発展に貢献していきます。

◎本件に関するお問い合わせ先：

AGC株式会社 広報・IR部長 小川 知香子

（担当：藤山 TEL: 03-3218-5603 E-mail: info-pr@agc.com）

*個人情報 は当社プライバシーポリシーに従ってお取り扱いをさせていただきます。

- * 1 DRAM : Dynamic Random Access Memory の略。半導体記憶装置（半導体メモリー）の一種で、一般的にはパソコン用のメインメモリー（主記憶装置）などに使われている。
- * 2 2020年7月27日発表、「EUV 露光用フォトマスクブランクス供給体制を大幅増強」
https://www.agc.com/news/detail/1201108_2148.html

以上

<ご参考>

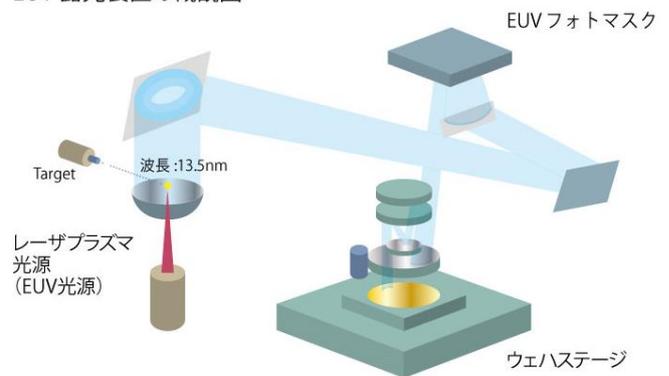
■ EUV マスクブランクスについて

EUV マスクブランクスは、低膨張ガラス基板の表面に複数の組成から成る膜を積層したものです。EUV マスクブランクス表面に半導体チップの回路原版を形成したものが EUV フォトマスクであり、その回路をシリコンウェハ上に転写して半導体チップを形成します。回路の微細化に伴い、EUV マスクブランクスに対する、

- ・非常に小さなサイズの欠陥を限りなくゼロに近づけること
- ・非常に高い平坦度であること

といった要求水準は、更に高くなっています。

EUV 露光装置の概観図



■ AGC エレクトロニクスについて

社名	AGC エレクトロニクス株式会社
資本金	300 百万円
代表	佐藤 弘昌
本社所在地	福島県郡山市
従業員数	約 700 名
主な事業内容	ガラスフリット・ペースト、光ピックアップ等のオプトエレクトロニクス製品、及び半導体製造装置用合成石英製品、EUV 露光用フォトマスクブランクス

◎本件に関するお問い合わせ先：

AGC株式会社 広報・IR 部長 小川 知香子

(担当：藤山 TEL: 03-3218-5603 E-mail: info-pr@agc.com)

*個人情報は当社プライバシーポリシーに従ってお取り扱いをさせていただきます。